



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

11049936 A

(43) Date of publication of application: 23 . 02 . 99

(51) Int. CI

C08L 63/00

C08G 59/14

C08G 59/20

C08G 59/62

C08K 3/04

C08K 3/36

H01L 23/29

H01L 23/31

(21) Application number: 09213202

(22) Date of filing: 07 . 08 . 97

(71) Applicant:

SUMITOMO BAKELITE CO LTD

(72) Inventor:

ASADA YASUTSUGU

(54) EPOXY RESIN COMPOSITION AND SEMICONDUCTOR DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide semiconductor sealing epoxy resin compositions excellent in YAG laser marking properties.

SOLUTION: Resin compositions comprise, as the essential components, an epoxy resin containing not less than 30 wt.% dicyclopentadiene-modified phenolic epoxy resin in

the entire epoxy resin, a phenolic resin curing agent, spherical fused silica comprising not less than 15 wt.% particles having a particle diameter of not greater than $6~\mu m$ in the total spherical fused silica, a curing accelerator and carbon black having a particle diameter of 15-100 nm. In this case, the resin compositions comprise 76-88 wt.% spherical fused silica and 0.15-0.65 wt.% carbon black.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-49936

(43)公開日 平成11年(1999) 2月23

	<u> </u>				(and and but	1 WALLE (1999) 7 H 53
(51) Int.Cl.*		識別記号		F I		
COSL	63/00	,				•
C08G	59/14			C08L 63/00		C .
, , ,	•			C08G 59/14		
	59/20			59/20	1	
	59/62			59/62		
C08K	3/04			C08K 3/04		
			審査請求	• -		
			西上明人	未請求請求項の数	(2 OL (全	5 頁) 最終頁に続く
(21) 出顧番号		特顧平9-213202		(71)出顧人 000	002141	
22) 出顧日		平成9年(1997)8月7日			マベークライト校 (都品川区東品川	大会社 12丁目5番8号
					康嗣	
			4			IOTECHAR A.
,						12丁目5番8号 住友
			ĺ	7/	クライト株式会	社内
		- ×		•	7	
			9 1			

(54) 【発明の名称】 エポキシ樹脂組成物及び半導体装置

(57)【要約】

YAGレーザーマーキング性に優れた半導体 封止用エポキシ樹脂組成物を提供すること。

【解決手段】 全エポキシ樹脂中にジシクロペンタジェ ン変性フェノール型エポキシ樹脂を30重量%以上含む エポキシ樹脂、フェノール樹脂硬化剤、全球状溶融シリ カ中の15重量%以上が粒径6µm以下である粒子から なる球状溶融シリカ、硬化促進剤、及び平均粒径が15 ~100nmであるカーポンプラックを必須成分とする 樹脂組成物において、全樹脂組成物中に球状溶融シリカ を76~88重量%、カーポンプラックを0.15~ 0.65重量%含むことを特徴とする半導体封止用エポ キシ樹脂組成物。

○全沙内·15~7%以上か、栽培6~~以下 a、判力の脱落防止

b. 光の記を針

C、マークのエッジのギザギザ防止

しずにかが近がたかない シリカが老面に残る。だからので

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 全エポキシ樹脂中にジシクロペン タジエン変性フェノール型エポキシ樹脂を30重量%以 上含むエポキシ樹脂、(B)フェノール樹脂硬化剤、

(C) 全球状溶融シリカ中の15重量%以上が粒径6μ m以下である粒子からなる球状溶融シリカ、(D)硬化 促進剤、及び(E) 平均粒径が15~100nmである カーボンブラックを必須成分とする樹脂組成物におい て、全樹脂組成物中に球状溶融シリカ(C)を76~8 8重量%、カーポンプラック(E)を0.15~0.6 5重量%含むことを特徴とする半導体封止用エポキシ樹

【請求項2】 請求項1記載の半導体封止用エポキシ樹 脂組成物を用いて封止してなることを特徴とする半導体

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、YAGレーザーマ ーキング性に優れた半導体封止用エポキシ樹脂組成物及 びこれを用いた半導体装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、主にエポキシ樹脂組成物等で封止 された半導体装置は、熱硬化型もしくはUV硬化型の特 殊なインクで品名やロット番号等がマーキングされてい るが、マーキングやその硬化に時間がかかり、更にイン クの取り扱いも容易でないため、最近はレーザーマーキ ングを採用する電子部品メーカーが増加している。YA G又は炭酸ガスのレーザー光線を短時間照射してエポキ シ樹脂組成物の成形品表面へマーキングする方法は、イ ンクによるマーキングよりも作業性に優れ、しかも短時 間で終了するために、電子部品メーカーにとっては利点 が多い。

【0003】しかし、従来の半導体封止用エポキシ樹脂 組成物(以下、樹脂組成物という)を用いて封止した半 導体装置の表面にレーザーマーキングした場合、マーキ ングされた部分とマーキングされていない部分とのコン トラストが不鮮明であり、しかも印字が黄色になるため に、印字の読みとりが困難である。中でも、硬化性、硬 化物の低吸水性や高密着性等のパランスの良さを生かし を用いた樹脂組成物は需要が急速に拡大している。しか し、ジシクロベンタジエン変性フェノール型エポキシ樹 脂は、樹脂自体が着色しているうえ、マーキング時に熱 により変色を受けるため印字のコントラストが悪く、ス スも発生しやすいため印字の読みとりが困難であるとい う問題があった。炭酸ガスレーザーマーキングに関して は、既に効果的な着色剤が開発され、鮮明な印字が得ら れる樹脂組成物が上市されている。ところが、YAGレ ーザーマーキングに関しては、例えば特開平2-127 449号公報によると、「カーボン含有量が99.5重 50 が好ましい。

量%以上、水素含有量が0.3重量%以下であるカーボ ンブラック」が同目的に効果的であると記載されてお

り、又その他の種々の研究がなされているが、カーボン ブラックが揮散した後の印字のコントラストが未だ不充 分で、鮮明でなく、優れたYAGレーザーマーキング性 を有する半導体封止用樹脂組成物が要求されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、優れたYA Gレーザーマーキング性、信頼性を有する半導体封止用 10 エポキシ樹脂組成物及びこれを用いた半導体装置を提供 するものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、(A)全エポ キシ樹脂中にジシクロベンタジエン変性フェノール型エ ポキシ樹脂を30重量%以上含むエポキシ樹脂、(B) フェノール樹脂硬化剤、(C)全球状溶融シリカ中の1 5 重量%以上が粒径 6 µm以下である粒子からなる球状 溶融シリカ、(D)硬化促進剤、及び(E)平均粒径が 15~100nmであるカーボンブラックを必須成分と 20 する樹脂組成物において、全樹脂組成物中に球状溶融シ リカ (C) を76~88重量%、カーポンプラック (E) を0.15~0.65重量%含むことを特徴とす る半導体封止用エポキシ樹脂組成物であり、これを用い た半導体装置は、優れたYAGレーザーマーキング性を 示し、鮮明な印字を得ることができる。

[0006]

【発明の実施の形態】以下、各成分について説明する。 本発明に用いるエポキシ樹脂は、ジシクロペンタジエン 変性フェノール型エポキシ樹脂を全エポキシ樹脂中に3 0重量%以上含むものである。このジシクロペンタジエ ン変性フェノール型エポキシ樹脂は、フェノール類とジ シクロペンタジエンとの重付加物のグリシジルエーテル 化物で、これを用いた樹脂組成物は優れた硬化性、硬化 物は低吸水性や高密着性等の優れた特性を有している。 ジシクロペンタジエン変性フェノール型エポキシ樹脂の 配合量は、全エポキシ樹脂中に30重量%以上が好まし い。30重量%未満だと、ジシクロペンタン構造による 硬化性、低吸水性、高密着性等の特性が樹脂組成物の特 性に反映されなくなるので好ましくない。併用できる他 たジシクロベンタジエン変性フェノール型エポキシ樹脂 40 のエポキシ樹脂は、1分子中に2個以上のエポキシ基を 有するものであれば特に構造を限定するものではない。 例えば、ピフェニル型エポキシ樹脂、ピスフェノール型 エポキシ樹脂、スチルベン型エポキシ樹脂、クレゾール ノボラック型エポキシ樹脂、及びこれらの変性物等が挙 げられる。これらは単独でも、混合して用いても差し支 えない。これらのエポキシ樹脂は、半導体封止用として の耐湿信頼性を考慮すると、イオン性不純物であるNa イオンやClイオンが極力少ない方が好ましく、硬化性 の点からエポキシ当量としては150~300g/eq

以下のものが好ましい。

【0007】本発明に用いるフェノール樹脂は、1分子 中にフェノール性水酸基を2個以上有するものならば、 特に限定するものではないが、例えば、フェノールノボ ラック樹脂、ジシクロペンタジエン変性フェノール樹 脂、キシリレン変性フェノール樹脂、トリフェノールメ タン型樹脂及びこれらの変性樹脂等が挙げられる。これ らは単独でも、混合して用いても差し支えない。硬化性 の点から、水酸基当量としては80~250g/egが 好ましい。

【0008】本発明に用いる球状溶融シリカは、全球状 10 溶融シリカ中の15重量%以上が粒径6 µm以下である 粒子からなり、本発明の課題である優れたYAGレーザ ーマーキング性を得るための第一のポイントである。粒 径6μm以下の粒子の割合は、レーザー回折式粒度分布 測定機(シーラス社・製、モデル715)で測定するこ とができる。本発明の球状溶融シリカを配合した樹脂組 成物を成形して得られた成形品の表面に、YAGレーザ -マーキングする際、シリカが脱落して生じる深い陥没 部分が減少し、印字表面にできる蔭が少なくなる。更 に、粒径 6 μm以下の粒子による光の乱反射が効果的に 20 得られ、印字のコントラストが向上するため、鮮明な印 字が得られる。又、粒径6μm以下の粒子が15重量% 以上存在すると、マーキングされた印字のエッジ部のギ ザギザが滑らかになり、字体が整って認識しやすくなる 効果を付与すると共に、エッジ部分のギザギザに起因す る印字の欠けやぼやけを抑えることができ、優れたYA Gレーザーマーキング性が得られる。粒径 6 μm以下の 粒子が15重量%未満だと、効果的な光の乱反射が得ら れず、エッジ部のギザギザ、欠け、ぼやけ等を抑えるこ とができなくなり、良好なYAGレーザーマーキング性 が得られないので好ましくない。本発明の球状溶融シリ カの配合量は、優れたYAGレーザーマーキング性を実 現するための第2のポイントで、全樹脂組成物中に76 ~88重量%である。YAGレーザーマーキングにより 印字ができるのは、YAGレーザー光線のもつエネルギ −によって、カーポンと樹脂成分が焼き飛び、シリカが 表面に残り、白く発色するためである。従って、76重 量%未満だと、樹脂成分による印字の着色の影響が大き く、良好なYAGレーザーマーキング性を得るために てくるので好ましくない。一方、88重量%を越える と、樹脂組成物として充分な流動性を得られなくなるの で好ましくない。この球状溶融シリカの製法等について は、特に限定しない。更に、粒径については、成形時の 金型の細部への充填性の点から、最大粒径は150 μm

【0009】本発明に用いる硬化促進剤は、エポキシ基 とフェノール性水酸基との反応を促進するものであれば よく、一般に封止材料に使用されているものを利用する ことができる。例えば、1,8-ジアザビシクロ(5, 4,0)ウンデセンー7、トリフェニルホスフィン、ベ ンジルジメチルアミン、2-メチルイミダゾール等が挙 げられる。これらは単独でも、混合して用いて差し支え

【0010】本発明に用いるカーボンプラックの平均粒 径は、15~100nmが好ましく、配合量は、全樹脂 組成物中に0.15~0.65重量%が好ましい。この 平均粒径と配合量が、本発明の技術上の第二のポイント である。カーボンブラックの平均粒径は、顕微鏡観察に より測定することができる。カーボンプラックの平均粒 径が15nm未満だと、YAGレーザー光線を受けた時 の揮散力が弱くなり、充分なYAGマーキング性が得ら れないので好ましくない。一方、100ヵmを越える と、着色剤としての着色性が低下し、印字と白黒のコン トラストが悪化し、良好なYAGマーキング性が得られ ないので好ましくない。カーボンブラックの配合量が、 全樹脂組成物中に0.15重量%未満だと、成形品の着 色性が不足し、成形品自体の色が淡灰色になってしまう ため、充分な印字と白黒のコントラストが得られないの で好ましくない。一方、0.65重量%を越えると、力 ーポンプラックを焼き飛ばした後に印字表面に残るスス が増加し、印字が灰色になってしまうため、印字と周囲 とのコントラストが低下するので好ましくない。カーボ ンブラックの凝集形態等は、特に限定するものではな 30 く、不純物等のレベルが封止材料に適用できるものであ ればよい。

【0011】本発明の樹脂組成物は、(A)~(E)成 分を必須成分とするが、これ以外に必要に応じてカップ リング剤、難燃剤、離型剤、低応力添加剤等の添加剤を 適宜配合してもよい。又、本発明の樹脂組成物は、

(A) ~ (E) 成分、及びその他の添加剤等をミキサー 等で均一に混合した後、加熱ロール又はニーダー、押出 機等で溶融混練し、冷却後粉砕して得られる。本発明の 樹脂組成物を用いて、半導体等の電子部品を封止し、半 は、樹脂の熱による変色防止等の別の手段が必要となっ 40 導体装置を製造するには、トランスファーモールド、コ ンプレッションモールド等の従来からの成形方法で硬化 成形すればよい。

[0012]

【実施例】以下、本発明を実施例で具体的に説明する。 配合単位は重量部とする。

実施例1

ジシクロベンタジエン変性フェノール型エポキシ樹脂(以下、エポキシ樹脂I という:大日本インキ化学工業(株)・製、軟化点55℃、エポキシ当量265 g/eq)

フェノールノボラック樹脂(軟化点65℃、水酸基当量104g/eq)

4.5重量部

球状溶融シリカ (粒径6μm以下の粒子22重量%)

トリフェニルホスフィン

82重量部

0.2重量部

カーボンブラック (平均粒径22nm、比表面積110m2/g)

0.2重量部

三酸化アンチモン カルナバワックス

1.0重量部

シリコーンオイル

0.4重量部 0.2重量部

をミキサーを用いて常温混合し、80~100℃の加熱 ロールで溶融混練し、冷却後粉砕し、樹脂組成物を得 た。得られた樹脂組成物を以下の方法で評価した。結果 を表1に示す。

【0013】評価方法

スパイラルフロー: EMM I - I - 6 6 に準じた金型を 用い、樹脂組成物を低圧トランスファー成形機を用いて 175℃、射出圧70kgf/cm²、保圧時間120 秒の条件で成形し、スパイラルフローを測定した (単位 満を不合格、70cm以上を合格とした。

YAGレーザーマーキング性: 低圧トランスファー成形 機を用いて、175℃、射出圧70kgf/cm²、保 圧時間120秒の条件で80pQFP (2.7mm厚) を成形し、得られた成形品を、更に175°Cで8時間ポ ストキュアし、YAGレーザーマーキング用サンブルと した。得られたサンプルを日本電気 (株)・製のマスク タイプのYAGレーザーマーキング機(印加電圧2.4 kV、パルス幅120µsの条件)でマーキングし、印 字の視認性 (マーキング性) を評価した。

耐半田信頼性:低圧トランスファー成形機を用いて、1 75℃、射出圧70kgf/cm²、保圧時間120秒 の条件で80pQFP(2.7mm厚)を成形し、得ら

れた成形品を、更に175℃で8時間ポストキュアし、 125℃で20時間乾燥した後、85℃、相対湿度85 %の吸湿槽で168時間吸湿させ、IRリフロー240 ℃/10秒の半田処理を行い、外部クラックの発生状態 を調べた。5~10倍の顕微鏡を用いて外観検査をし、 異常のないものを○、ふくれやクラックの生じているも のを×とした。

離型性:低圧トランスファー成形機を用いて、175 *C、射出圧70kgf/cm²、保圧時間40秒の条件 cm)。スパイラルフロー判定基準として、70cm未 20 で80pQFP(2.7mm厚)を成形し、問題なく離 型するものを〇、樹脂残りやカル落ち、ランナー折れな どが発生したものを×とした。

【0014】実施例2~9、比較例1~9

実施例1と同様にして樹脂組成物を製造し、実施例1と 同様にして評価した。結果を表1、表2に示す。なお、 実施例8、比較例8に用いたエポキシ樹脂IIは、油化シ ェルエポキシ (株)・製 YX4000 (融点105 ℃、エポキシ当量195g/ea)である。実施例9、 比較例9に用いたエポキシ樹脂IIIは、日本化薬(株) ・製 o-クレゾールノボラック樹脂(軟化点62°C、 エポキシ当量205g/е q) である。

【表1】

	-11	-							
	,		1						
					& 施	例			
エポキシ樹脂!	 	2	3	4	5	6	7	8	9
エポキシ樹脂Ⅱ	11.5	9.4	14.4	11.5	11.5	11.2	11.5	4.2	
エポキシ核脂血	 	<u> </u>						6.4	
フェノールノボラック樹脂									6.
球状溶脱シリカ	4.5					4.4	4.5	5.4	
	82	85		82		82	82	82	8:
粒径 6 μ m 以下 (亜量%) カーボンブラック (平均粒径22 n m)		(21)	(22)	(16)	(38)	(24)	(22)	(21)	(22)
カーポンプラック (平均粒を86 n m)	D. 2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6		0. 2	0. 2
トリフェニルホスフィン							0.2		
三酸化アンチモン	0. Z	0. 2	0. 2	0.2	0.2	0.2	0.2	0. 2	0. 2
カルナパワックス	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
シリコーンオイル	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
スパイラルフロー (cm)	0. 2	0. 2	0. 2	0.2	0.2	0.2	0.2	0. 2	0. 2
YAGレーザーマーキング性	120	90	135	110	_135	120	120	150	85
以半田信頼性 ・ コンラ E	$-\times$ $+$	$-\mathcal{V}$	Q	0	0 1	\overline{o}	01	0	Ô
農型性	$- \times - 1$	$-\lambda$	-Q	<u>. O I</u>	0	0	01	0	Ŏ
第合判定	- X	$\frac{Q}{Q}$	01	Q I	0	0	0	ŏ	δ
	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

8

			2	- 2					
	比 較 例								
ş • <u> </u>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
エポキシ樹脂【	18.0	6. 5	11.5	11.6	10.9	11.3	11.3	2.1	2. 1
エポキシ樹脂丁	1.							8. 5	
工术丰沙樹脂皿									8. 8
フェノールノボラック樹脂	7.0	2, 5	4.5	4.5	4, 5	4.5	4. 5	5.4	5. 4
球状溶融シリカ	73	90	82	82	82	82	82	82	82
粒径 6 µm以下(重量%)	(21)	(22)	(11)	(22)	(21)	(22)	(21)	(22)	(22)
カーボンプラック (平均粒径 10nm)						0.4			
カーボンブラック (平均粒径 22nm)	0. 2	0.2	0.2	0.1	0.8		-	0.2	0.
カーボンプラック (平均粒径120nm)							0.4		
トリフェニルホスフィン	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0. 2	0. 2	0.2	0. 2
三酸化アンチモン	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.6
カルナパワックス	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
シリコーンオイル	0. 2	0. 2	0. 2	0.2	0.2	0. 2	0. 2	0.2	0.
スパイラルフロー(cm)	160	50	110	115	110	115	110	170	65
YAGレーザーマーキング性	Δ	0	Δ	×	_ X	×	X	0	0
耐半田信頼性	0	0	0	0	0	0	0	0	X
離型性	0	0	0	0	0	0	0	X	0
総合判定	不合格	不合格	不合格	不合格	不合格	不合格	不合格	不合格	不合格

[0016]

【発明の効果】本発明に従うと、従来技術では得られな かった、印字が白く、且つコントラストの鮮明なYAG レーザーマーキング性に優れた半導体封止用エポキシ樹

脂組成物を得ることができる。従って、電気、電子部品 の封止用に用いた場合、YAGレーザーマーキングによ る鮮明な印字が高速、且つ低電圧で得られるので、工程 短縮、経費削減に大きな効果がある。

フロントページの続き

(51) Int.Cl.6

識別記号

FΙ C 0 8 K 3/36

C 0 8 K HO1L 23/29

23/31

3/36

H01L 23/30

R